PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

06-260756

(43)Date of publication of application: 16.09.1994

(51)Int.Cl.

H05K 3/40 H05K 3/06 H05K 3/42 H05K 3/46

(21)Application number : 05-069246

(22)Date of filing:

: 05-069246 04.03.1993 (71)Applicant:

IBIDEN CO LTD

(72)Inventor:

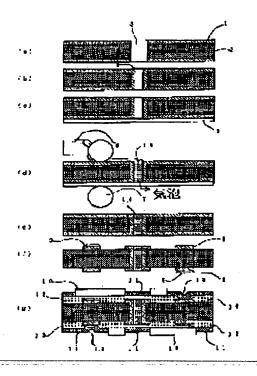
MURASE HIDEKI ASAI MOTOO

(54) MANUFACTURE OF PRINTED WIRING BOARD

(57)Abstract:

PURPOSE: To enable filler material paste to be filled into a through-hole provided to a board without mixing air bubbles into it by a method wherein air-permeable base material is brought into close contact or made to come in contact with the one side of the board, and filler paste is filled into the through-hole by pressure from the other side.

CONSTITUTION: A hole 3 is provided to a base material, and conductor is formed on the inner wall of the hole 3 for the formation of the base material provided with a through-hole 4. Airpermeable base material 5 is brought into close contact or made to come in contact with the one side of the board provided with the through-hole 4, and filler paste 14 is filled into the through-hole 4 by pressure from the other side of the board. For instance, when a multilayer printed wiring board is formed, a through-hole 3 is provided to a double-sided copper plated laminate board, and copper is deposited on the inner wall of the through-hole 3 for the formation of a copper-plated through-hole 4. Then, a sheet of Japanese paper 5 is placed on the laminated board, and filter material paste 14 is filled into the through-hole 4 from the other side by pressure with a roll coater 7.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

24.09.1998

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

04.01.2000

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-260756

(43)公開日 平成6年(1994)9月16日

(51) Int.Cl. ⁵		識別記号	庁内整理番号	FI	技術表示箇所
H05K	3/40	K	7511-4E		
	3/06	E	6921-4E		
	3/42	В	7511-4E		
	3/46	N	6921-4E		
				審査請求	未請求 請求項の数3 FD (全 6 頁)
(21)出願番号		特願平5-69246		(71)出願人	000000158
•					イビデン株式会社
(22)出願日		平成5年(1993)3月4日			岐阜県大垣市神田町2丁目1番地
				(72)発明者	村瀬 秀樹
					岐阜県揖斐郡揖斐川町北方1-1 イビデ
					ン株式会社内
				(72)発明者	浅井 元雄
					岐阜県揖斐郡揖斐川町北方1-1 イビデ
					ン株式会社内

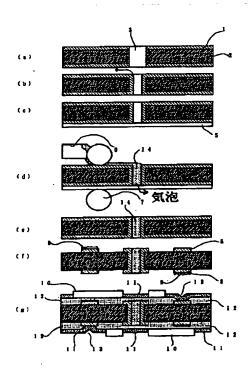
(54) 【発明の名称】 プリント配線板の製造方法

(57)【要約】

【目的】 気泡を混入させることなく、スルーホールにペースト状の充填材を充填する。

【構成】 少なくとも下記の(a)~(c)の工程を含むことを特徴とするプリント配線板の製造方法。

- (a) 基体にスルーホール用の貫通孔を設けた後、貫通 孔内壁に導体回路を形成し、スルーホールを有する基板 を製造する工程。
- (b) スルーホールを有する基板の一方の面に、通気性フィルムを密着させる工程。
- (c) 通気性のフィルムを密着させた面の反対側の面からペースト状の充填材料を圧入する工程。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 少なくとも下配の-(a)~(c)の工程 を含むことを特徴とするプリント配線板の製造方法。

- (a) 基体にスルーホール用の貫通孔を設けた後、貫通 孔内壁に導体を形成し、スルーホールを有する基板を製 造する工程、
- (b) スルーホールを有する基板の一方の面に、通気性 基体を密着あるいは接触させる工程、
- (c) 通気性基体を密着あるいは接触させた面の反対側 の面からペースト状の充填材料を圧入する工程。

前記通気性基体は、繊維質フィルムある 【請求項2】 いは多孔質基体からなる請求項1に記載のプリント配線 板の製造方法。

【請求項3】 前記充填材料は、熱硬化性耐熱樹脂、感 光性耐熱樹脂、熱可塑性耐熱樹脂である請求項1に記載 のプリント配線板の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明はプリント配線板とその製 造方法に関し、特にはスルーホールの接続信頼性と基板 20 表面の平滑性に優れたプリント配線板の製造方法に関す る。

[0002]

【従来の技術】近年、電子機器の小型化、モジュール化 が進む中で、ハイブリッドモジュールに使用されるプリ ント配線板も、より高密度化が要求されている。このよ うな要求に対して、スルーホールを有する両面 (多層) プリント配線板が製造されている。スルーホールを有す るプリント配線板を製造する場合には、感光性ドライフ ィルムを用いて、パターンをエッチングして回路を形成 30 するテンティング法が使用されている。しかしながら、 この方法は、ドライフィルムがスルーホール部分で破損 しやすく、エッチングの際、スルーホール内壁を溶解さ せてしまうという欠点があった。また、感光性ドライフ ィルムの代わりに液状の感光性樹脂液を塗布する方法が あるが、スルーホールの存在のため、基板表面に均一に 塗布することが困難であるという問題があった。また、 スルーホールを有する基板をピルドアップ多層配線板の 内層に使用すると、層間絶縁材層を設けた際、スルーホ ール部分が窪んでしまい、層間絶縁材層の層厚みがばら 40 つくため、インピーダンスの制御が困難であり、パッド 部分に凹部が生じた場合、ICの実装信頼性が低下する という問題が見られた。

【0003】以上のような問題のため、従来は、スルー ホール用の貫通孔内壁に導体を形成し、スルーホールと した後、このスルーホールにペースト状の充填材料を充 填し、プリント配線基板の表面を平滑にする方法がとら れていた。

【0004】しかしながら、ペースト状の充填材料を充

填されやすく、しかも前記充填された材料の表層は、比 較的容易に硬化するため、気泡が抜けがたくなり、基板 表面の残余の充填材料を研磨等で除去すると、基板表面 に窪みが残ってしまう。また、充填材料中に空気が閉じ 込められると、熱圧着などにより、電子部品を搭載する 際、熱膨張などで破壊がおこり、耐熱性が低下してしま う、さらに吸湿しやすく絶縁性が悪いなどの問題が見ら れた。

【0005】このため、充填材料を充填するにあたり、 充填材料中の気泡を除去する方法が種々開発されてお り、例えば、特開昭62-173794号には、セラミ ック基板のスルーホールに充填材料を充填した後、溶剤 に充填材料を接触させ、表面の粘度と表面張力を低下さ せることにより、気泡を除去する方法が開示されてい る。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】しかし、この方法は、 充填材料表面の粘度と表面張力を低下させるので、充填 材料が流れ出さないようにその粘度と表面張力を管理し なければならず、量産の際、品質管理しにくいという問 顋が見られた。

【0007】以上のように、気泡を混入させることな く、スルーホールにペースト状の充填材料を充填する方 法の開発が望まれていた。本発明者らは、鋭意研究した 結果、通気性基体を利用することにより、上述の問題を 解決できることを見出した。

[0008]

【課題を解決するための手段及び作用】本発明は、少な くとも下記の(a)~(c)の工程を含むことを特徴と する両面あるいは多層プリント配線板の製造方法、

- (a) 基体にスルーホール用の貫通孔を設けた後、貫通 孔内壁に導体を形成し、スルーホールを有する基板を製 造する工程、(b) スルーホールを有する基板の一方の 面に、通気性基体を密着あるいは接触させる工程、
- (c) 通気性基体を密着あるいは接触させた面の反対側 の面からペースト状の充填材料を圧入する工程、からな る。なお、スルーホールを有する基板の一方の面に、通 気性基体を接触させた場合、加圧しながらペースト状の 充填材料を充填するため、充填時点では基板と通気性基 体は密着している。

【0009】本発明は、スルーホールを有するプリント 配線板の一方の面に、通気性基体を密着させ、ペースト 状の充填材料を圧入することが必要である。この理由 は、ペースト状の充填材料中に気泡が入っていたとして も、圧入の際、通気性基体を透過してしまい、また充填 材料自体は、基体を透過することはないため、スルーホ 一ル中に充填材料が密に充填される。このため、基板の 表面平滑性が優れ、また、スルーホールの内壁が確実に 保護されるため、エッチングの際に溶解することがない 填する場合、ペースト中に空気が巻き込まれた状態で充 50 ため、スルーホールの接続信頼性が向上する。

【0010】本願発明で、使用される通気性基体とは、空気は透過するが、充填材料は透過しないような膜や板状のものを指し、例えば、繊維質フィルム、多孔質基体などがよい。

【0011】繊維質フィルムとしては、濾紙、和紙、などの紙類が、多孔質基体としては、セラミック板などがよい。この理由は、これらは、通気性に優れ、スルーホール内のエアー抜けを容易にし、充填樹脂の抜けおちを防止する効果があるからである。

【0012】本発明で使用されるペースト状充填材料と 10 しては、熱硬化性耐熱樹脂、感光性耐熱樹脂、熱可塑性耐熱樹脂などの絶縁性樹脂が望ましく、例えば、エボキシ系樹脂においては、エピコート828、1001(いづれも油化シェルの商品名)、EOCN-104S(日本化薬の商品名)などがよい。また、前記ペースト状充填材料は、フィラーを含有してもよい。フィラーとしては、エボキシ樹脂微粉末、アミノ樹脂粉末、無機質微粉末などがよい。この理由は、充填樹脂の硬化収縮の緩和などの効果があるからである。

【0013】前配ペースト状充填材料の粘度は、塗布法 20 にもよるが、1~10 Pa・sがましい。この理由は、1 Pa・s未満では、スルーホール内に充填された樹脂が基体にしみ込みその結果、スルーホール内の樹脂が不足し、くぼみや樹脂抜けが発生し、10 Pa・sを超えると充填材料中の気泡が抜けにくく、レペリング性が悪いからである。前配ペースト状充填材料の粘度調整は、メチルエチルケトン、メチルセロソルプ、プチルセロソルプ、プチルセロソルプアセテート、プチルカルピトール、プチルセルロース、テトラリン、ジメチルホルムアミド、ノルマルメチルピロリドンなどの溶剤を使用 30 することが望ましい。

【0014】本発明において、ベースト状充填材料を圧入する手段は、ロールコータ、スージなどが望ましい。前配圧入の際の圧力は、 $1\sim 4~k~g/c~m^2$ が望ましい。この理由は、 $1~k~g/c~m^2$ 未満では樹脂が完全に充填しきらない可能性があり、また $4~k~g/c~m^2$ を超えると表面に塞みが発生しやすくなる。

【0015】前記ペースト状充填材料を圧入した後、ペースト状充填材料を乾燥硬化させ。また、乾燥硬化させた後、必要に応じて研磨やサンドプラストなどの方法にて、不要な充填材料を除去して表面を平坦にすることが望ましい。

【0016】本発明において、スルーホールの形成方法としては、常法の無電解めっき、あるいは電解めっきを行うことができる。めっきとしては、銅、ニッケル、金などが好適に用いられる。

【0017】本発明において、導体回路の形成方法としては、金属層をエッチングするサブトラクテティブ法、 導体回路を無電解めっき等で形成するアディティブ法な ど、種々の方法を利用できる。アディティブ法を使用し た場合、次のような工程によりプリント配線板を製造で きる。

- (a) 絶縁板あるいは金属板などの基板上に、後述のような無電解めっき用の接着剤層を形成、粗化し、これを基体とし、スルーホール用の質通孔を散けた後、パラジウムなどの触媒核を付与し、ついで必要に応じてめっきレジストを形成し、さらに貫通孔内壁および基板表面に導体回路を形成し、導体回路、スルーホールを有する基板を製造する工程。
- 10 (b) スルーホールを有する基板の一方の面に、通気性基体を密着あるいは接触させる工程。
 - (c) 通気性基体を密着あるいは接触させた面の反対側 の面からペースト状の充填材料を圧入する工程。
 - (d) 充填材料を硬化させる工程。

さらに必要に応じて残余の充填材料を研磨などにより除 去する工程などを採用してもよい。

【0018】サブトラクテクイブ法を使用した場合、次のような工程によりプリント配線板を製造できる。

- (a) 両面に金属層が設けられた基板を基体とし、これ のに、スルーホール用の貫通孔を設け、触媒核を付与して 無電解めっきを行い、貫通孔内に導体を設け、スルーホ ールを有する基板を製造する工程。
 - (b) スルーホールを有する基板の一方の面に、通気性 基体を密着あるいは接触させる工程。
 - (c) 通気性基体を密着あるいは接触させた面の反対側 の面からペースト状の充填材料を圧入する工程。
 - (d) 充填材料を硬化させる工程。
 - (e) エッチングレジストを形成、エッチングして導体 回路を形成する工程。必要に応じて残余の充填材料を研 磨などにより除去する工程などを採用してもよい。

【0019】本発明のプリント配線板は、両面(無論多層も含む)配線板である。

【0020】本発明のプリント配線板はピルドアップ多層プリント配線板の内層に応用した場合に有利である。この理由は、表面の平滑性に優れた多層プリント配線板を製造でき、電子回路部品の実装信頼性やインピーダンス制御が容易となるからである。ピルドアップ多層プリント配線板の製造方法としては、前配アディティブ、サプトラクテゥイプ法により製造した内層用プリント配線板の表面に感光性の接着剤層を形成、露光、現像して開口部を設け、この接着剤層の表面を粗化した後、無電解めっきを行い、接着剤層表面および開口部に導体回路を形成して、上層の導体回路と内層の導体回路を電気的に接続する。

【0021】本発明の導体回路をアディティブ法にて製造する場合は、接着剤として、酸もしくは酸化剤に対して難溶性の樹脂からなるマトリックス中に酸もしくは酸化剤に対して可溶性の硬化処理された耐熱性樹脂粉末が分散してなることが望ましく、その耐熱性樹脂粉末は、

ど、種々の方法を利用できる。アディティブ法を使用し 50 1) 平均粒径10μm以下、2) 前記耐熱性樹脂粉末は、

5

平均粒径2μm以下の耐熱性樹脂粉末を凝集させて平均 粒径2~10µmの大きさとした凝集粒子、3) 平均粒径 2~10μmの耐熱性樹脂粉末と平均粒径 2μm以下の耐 熱性樹脂粉末との混合物、4) 平均粒径2~10μmの耐 熱性樹脂粉末の表面に平均粒径2μm以下の耐熱性樹脂 粉末もしくは平均粒径2μm以下の無機粉末のいずれか 少なくとも1種を付着させてなる擬似粒子から選ばれる ことが望ましい。

【0022】上記接着材層は、酸あるいは酸化剤で粗化 することにより、粗化面を設けることができ、導体回路 10 工程(1):両面銅張積層板に、ドリルにて口径0.2 を無電解めっきにより形成しても、層間絶縁材層と導体 回路との密着を向上させることができるからである。前 記マトリックスの樹脂は、感光性であることが望まし い。感光性樹脂を使用することにより、露光、現像でパ イアホールを形成できるからである。前記接着剤は、ビ ルドアップ多層配線板では、層間絶縁剤層となる。ま た、このような接着剤層で形成されるアンカー形状、ア ンカー深さについては、粒径の異なるフィラーにて表面 粗度が1μm~20μmの範囲内になることが望まし く、その場合には導体の十分な密着強度が得られる。

【0023】本願の多層プリント配線板では、導体回路 と層間絶縁材層の界面に設けられる無電解めっき膜から なる粗化層が銅、ニッケル、リンから成る共晶化合物で あることが望ましい。この理由は、黒化還元処理面は表 面を酸化して酸化銅を表面に形成し、表面を粗化する が、この粗化層である酸化銅の強度が低く、これが熱衝 撃により破壊されて層間剥離を起こすが、本発明の共晶 めっきにより得られる共晶化合物は、強度が高いため熱 衝撃による層間剥離が生じにくく、ヒートサイクル特性 が向上するからである。また、このような共晶化合物 は、主に針状結晶となるため、アンカーとしての効果が 高く、導体回路と層間絶縁材層を密着させることができ るため、ヒートサイクル特性が向上する。更に黒化還元 処理後では酸化銅が表面に曝露されるため、酸溶液中で 溶解されやすく、いわゆるハローイング現象を生じやす いのに対して、このような処理法では金属が酸化されず に表面に形成されているため、溶解されず、高い密着力 を確保できる。

【0024】前記共晶化合物の銅、ニッケル、リンの含 有量は、それぞれ、90~96%、1~3%、0.5~ 40 2wt%程度あることが望ましい。上記範囲では、析出 被膜の結晶が針状構造になるため、アンカー効果に優れ るからである。前記粗化層の厚さは、5μmであること が望ましく、より望ましくは0. 5μm~2μmが望ま しい。この理由は、0.5μm以下では、アンカー効果 が低く、5 µm以上では、表面粗度が大きくなりすぎ、 逆に密着強度が低下してしまう。本発明の多層プリント 配線板は、基板上の導体回路と層間絶縁材層上に設けら れた導体回路がパイアホールやスルーホールで電気的に 接続されていてもよい。パイアホールで接続する場合、

6 接続箇所の粗化層は、予め除去されているか、粗化層を 設けないことが必要である。

[0025]

【実施例及び比較例】以下、本発明を具体化した実施例 1、比較例1とについて図面に基づき詳細に説明する。 【0026】実施例1

実施例1の多層プリント配線板の製造工程(1)~ (9) について、図1 (a) ~ (e) に基づき説明をす

mmの貫通孔を形成した。全面に、活性触媒付与、活性 化を行った後、常法に従い、無電解めっきを行い、貫通 孔の内壁に銅を析出させ、スルーホール9を形成した。 工程(2):前配スルーホールの形成された積層板に、 和紙8を乗せた。

工程(3):フェノールノポラック型エポキシ樹脂(油 化シェル製) 60重量部、ピスフェノールA型エポキシ 樹脂(油化シェル製) 40重量部およびイミダゾール系 硬化剤(四国化成製)5重量部をブチルセルソルプアセ 20 テートに溶解させて、この組成物の固形分100重量部 に対して、エポキシ樹脂微粉末を、粒径0.5μmのも のを15重量部、粒径5.5μmのものを30重量部の 割合で混合し、その後3本ロールで混練して、さらにプ チルセロソルプアセテートを添加し、固形分濃度75% のペースト状充填材料を作成した。この溶液の粘度は、 JIS-K7117に準じ、東京計器製デジタル粘度計 を用い、20℃で60秒間測定したところ、回転数6r pmで5. 2Pa·s、60rpmで2. 6Pa·sで あり、そのSVI値(チキソトロピック性)」は2.0で あった。

工程(4):ロールコータ11により、面圧力3kg/ cm² で上記充填材料をスルーホールに圧入した。

工程(5):上記充填材料を乾燥、加熱、硬化させ、余 剰の充填材料を研磨により除去し、平坦化した。

工程(6): 和紙を除去した後、ドライフィルムをラミ ネートし、これを露光現像し、エッチングレジストとし た。

工程(7):塩化第二銅水溶液によりエッチングを行 い、両面プリント基板(内層回路1)とした。スルーホ ールは充填材料で保護されているため、エッチングされ なかった。また、充填されたスルーホール内には気泡も 窪みも見られなかった。

工程(8):基板を酸性脱脂、ソフトエッチング硫酸活 性触媒付与、活性化を行った後、次の無電解めっき浴に てめっきを施し、Ni-P-Cu 共晶の厚さ 1μ mの凹 凸面2を得た。

無電解めっき浴

硫酸銅 : 10.1g/1硫酸ニッケル :1.0 g/150 次亜リン酸ナトリウム:20.2g/1 7

水酸化ナトリウム : 適量

pH = 9.0

工程(9):クレゾールノボラック型エボキシ樹脂(油化シェル製,商品名:エピコート180S)50%アクリル化物60重量部に、ピスフェノールA型エボキシ樹脂(油化シェル製,商品名:E-1001)40重量部、ジアリルテレフタレート15重量部、2-メチルー1-[4-(メチルチオ)フェニル]2-モルフォリノプロパノン-1(チバ・ガイギー製,商品名:イルガキュア-907)4重量部、粒径が5.5μmのエピキシ10樹脂微粉末(東レ製)10重量部、及び粒径が0.5μmのエボキシ樹脂微粉末(東レ製)25重量部を配合した。そして、この混合物にプチルセロソルブを適量添加しながらホモディスパー攪拌機で攪拌し、接着剤のワニスを作成した。

【0027】工程(10):ロールコータを用いて内層 回路1上に上記の接着剤ワニスを塗布した後、塗布され たワニスを100℃で1時間乾燥硬化させ、厚さ50μ mの感光性接着剤層(層間絶縁層)3を形成した。

工程 (11):次に、前配工程 (10)の処理を施した 20 配線板に直径 100μ mの黒円及び打ち抜き切断部位が 黒く印刷されたフォトマスクフィルムを密着させ、超高 圧水銀灯により 500mj/cm² で露光した。これを クロロセン溶液で超音波現像処理することにより配線板 上に直径 100μ mのパイアホールとなる開口 4 を形成した。

工程(12):次いで、前記配線板を超高圧水銀灯により約300mj/cm²で露光し、更に100℃で1時間及び150℃で3時間加熱処理した。これらの処理により、フォトマスクフィルムに相当する寸法精度に優れ 30た関口4を有する層間絶縁層3を形成した。

工程(13):そして、前記配線板をクロム酸に10分間浸渍することにより、層間絶縁層3の表面を粗化した。更に、中和後に水洗及び湯洗して、配線板からクロム酸を除去した。

工程(14):その後、配線板を市販のPd-Snコロイド触媒に浸漬して、閉口4の内壁面及び粗化された層間絶縁層3の表面にPd-Snコロイド5を吸着させた。その後、120℃で30分加熱処理した。

工程 (15): 前記配線板上にドライフィルムフォトレ 40 ジストをラミネートすると共に、露光現像を行ってメッキレジスト6を形成した。

工程(16):その後、還元剤としての37%のホルムアルデヒド水溶液に前配配線板を浸漬し、Pdを活性化させた。このときの処理温度は40℃,処理時間は5分である。

次いで、常法に従う無電解メッキ液に配線板を直ちに浸 漬し、その状態で15時間保持した。以上の各工程に経 ることによって、厚さ約 35μ m, $L/S=75\mu$ m/ 75μ mの導体回路7を備える4層プリント配線板を形 50 成した 。内層にスルーホールを有していても上層の膜 厚が均一になり、インピーダンスのばらつきは見られな かった。また、内層にスルーホールを有していてもパッ ドが平滑になるため、ICを実装しても不良は発生しな かった。また、特開昭62-173794号に見られた ような量産の際の品質管理の困難性もない。

8

【0028】 実施例2

実施例1と概ね同じであるが、充填材料を感光性樹脂であるクレゾールノボラック型エボキシ樹脂(油化シェル製、商品名:エピコート180S)50%アクリル化物60重量部に、ピスフェノールA型エボキシ樹脂(油化シェル製、商品名:E-1001)40重量部、ジアリルテレフタレート15重量部、2-メチルー1-〔4-(メチルチオ)フェニル〕2ーモルフォリノブロバノン-1(チパ・ガイギー製、商品名:イルガキュア-907)4重量部を混合した溶液とし、通気性基体として、セラミックス板を使用した。

【0029】 実施例3

ガラスエポキシ絶縁基板に、実施例1で調製した無電解めっき用接着剤を塗布し、露光、加熱により硬化、クロム酸溶液で粗化した後、ドライフィルムをラミネート、露光現像し、めっきレジストを設けた。さらに、バラジウム触媒核を付与、無電解めっきを行い、導体回路とスルーホールを形成した。ついで、充填用ペーストとして熱可塑性樹脂であるポリエーテルスルホン(PES)を用い、実施例1と同様に充填を行い、4層プリント配線板を形成した。

【0030】比較例1

比較例1では、基板にポリエチレンフィルムを密着させ、充填材料を圧入し、実施例1と同様に4層ビルドアップ配線板を得た。しかしながら、内層のスルーホール部分に気泡が入り、これが窪みとなり、表面のパッド部分に凹部が形成されてしまい、ICを実装できなかった。また、内層のスルーホール上の窪みにより、上層の膜厚制御が困難になり、その膜厚のパラツキがインビーダンスのばらつきになり、不良になってしまった。

【0031】比較例2

スルーホール基板に、ポリエチレンフィルムを密着させ、実施例1で得られた充填材料を圧入し、ついで特開 昭62-173794号でメチルエチルケトンをスプレーにより吹きつけ、充填材料中の気泡を除去した。しかしながら、一部スルーホールの充填材料が流れ出していることが確認された。

[0032]

【発明の効果】以上のように、本願発明によれば、スルーホールの接続信頼性に優れたプリント配線板を容易に 製造できるばかりでなく、実装信頼性を確保し、インピーダンス制御を容易に実現できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】図1の(a)~(g)は、実施例1の4層プリ

S

ント配線板の工程図。

【符号の説明】

- 1 金属層
- 2 絶縁板
- 3 貫通孔
- 4 スルーホール
- 5 和紙 (通気性基体)
- 6 充填材料受け

7 ロールコータ

- 8 内層回路
- 9 凹凸面 (Ni-P-Cu共晶めっき)

10

- 10 めっきレジスト
- 11 導体回路
- 12 層間絶縁層
- 13 パイアホール
- 14 充填材料

【図1】

